PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-127887

(43)Date of publication of application: 16.06.1986

(51)Int.Cl.

C25D 3/22

(21)Application number : 59-249055

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

HARIMA KASEI KOGYO KK

(22)Date of filing:

26.11.1984

(72)Inventor: ISHITOBI KOZO

TANDA TOSHIKUNI HAMADA MASAO **NOGUCHI HISAO**

(54) ACIDIC GALVANIZING BATH

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a highly lustrous and fine galvanized surface on which fingerprints are hardly left by adding polyacrylamide having a specified structure having cationic groups to a prescribed galvanizing bath. CONSTITUTION: Acrylamide is copolymerized with 1W20mol% cationic monomer, and the resulting polyacrylamide represented by general formula I is added to a prescribed acidic galvanizing bath by 0.2W20g/l. Polyacrylamide represented by general formula II may be added to the bath by 0.2W20g/I. The polyacrylamide is obtd. by copolymerizing acrylamide with 1W20mol% cationic monomer and ≥20mol% vinyl monomer. When the galvanizing bath contg. the copolymer represented by the formula I or II is used, a

highly lustrous galvanized surface on which fingerprints are hardly left can be formed under various galvanizing conditions.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-127887

⑤Int.Cl.4
C 25 D 3/22

識別記号 101

庁内整理番号 6686-4K

匈公開 昭和61年(1986)6月16日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

図発明の名称 酸性電気亜鉛めつき浴

②特 願 昭59-249055

塑出 願 昭59(1984)11月26日

⑫発 明 者 石 釆 宏 蒧 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内 73発 明者 丹 Œ 俊 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内 邦 明者 勿発 浜 H īΕ 男 加古川市野口町水足671番4号 播磨化成工業株式会社中 央研究所内 ②発 明 者 野 久 夫 加古川市野口町水足671番 4号 播磨化成工業株式会社中 央研究所内

⑪出 願 人 川崎製鉄株式会社 神戸市中央区北本町通1丁目1番28号 ⑪出 願 人 播磨化成工業株式会社 加古川市野口町水足671番4号

90代 理 人 弁理士 渡辺 望稔 外1名

99 /18 29

1.発明の名称

酸性電気亜鉛めっき器

2. 特許請求の範囲

(1)アクリルアミドを主体とし、カチオン性モノマーを1~20モル%共近合させた

一股式

Y: OtttNH

X:ハロゲン、無機または有機酸除イオン

R 1 . R 2 . R 3 :

Hatte CH3 atte C2 H5

n : 1 ~ 2

で示されるカチオン性品を含有するポリアクリルアミドを0.2~20g/2含有することを特徴とする酸性電気照朔めっき粉。

(2) アクリルアミドを主体とし、カチオン情 モノマーを1~20モル%、ビニルモノマーを 20モル%以下共販合させた

$$\begin{pmatrix}
CH - CH_2 \\
C = O \\
NH_2
\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}
CH - CH_2 \\
C = O \\
Y \\
(CH_2)_n \\
R_1 - N - X \\
R_2 & R_3
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\
V & W
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH - CH \\$$

Y:OxtdNH

X: ハロゲン、無機または有機静陰イオン

R 1 . R 2 . R 3 :

H E たは C H 3 E た は C 2 H 5

n : 1 ~ 2

V.W:H.CNIELCOOH

で示されるカチオン性基を含有するポリアクリルアミドを0.2~20g/2含有することを特徴とする酸性混気亜鉛めっき裕。

3 . 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本免明は、光沢度が高く、指紋が付許しにく い電気亜鉛めっきを得るための機性めっき狢に関 するものである。

<従来技術とその問題点>

で気 無 斜めっき 鋼板はその用途として、 音響機器のシャーシ、 アンブ、 カセットデッキ、 チューナ などのパネルの一部あるいはスピーカー などに用いられる ことが多く なっている。 このような場合、 亜鉛 めっき 鋼板は、全面あるいは一部が表決のまま、 製品として組み立てられることが多い。 この 和 み立て工程中に作業者が亜鉛めっき 要面を 手で触れると、指紋が黒っぽく鮮明に残るという問題点がある。

この指数付券現象は、頭角結晶の数細な凹凸の凹部に皮膚分泌物が埋め込まれる結果、その部分だけ拡散反射が起こらず、光が吸収され、黒ずんで見えるために鮮明に目立つものである。この現象は亜鉛めっき表面の防錆を目的としたクロメート 処理の有無にかかわらず起こる。一旦表面に付去した指数は有機溶剤などによっては容易に除去

されず、 美観 ヒ、 商品価値を考しく損なうもので ある。

・指数の付着しにくい電気亜鉛めっきを仰るためにはめっき面を低皮積ナトリウムのステリーで研磨し、光沢を上げれば効果があることがわかっている(特開呀57-85990号参照)。

また、めっき要面の光沢を上げるには、めっき裕 にチオ尿素、アラビアゴム、クレゾール、デキス トリン、ブドウ醇、クマリン等の光沢剤を添加す れば効果のあることが知られている。

一方、鋼板ストリップの電気亜鉛めっきでは、 電液医度を上げて高速でめっきできることから酸 酸塩、塩化物あるいはそれらの配合物を主成分と した叫約1~4の酸性めっき浴が用いられる。こ の酸性浴では、従来の光沢剤を添加しても狭い電 流密度範囲でしか効果がなく、高電流密度では めっきヤケ等の欠路を生じやすい。また、浴中で 光沢剤の安定性が悪く、とくに浴温が高い場合は 効果が減退する傾向が強かった。

このような中でめっき裕中に安定した群後状態

で 存 任 する 光 沢 例 の 一 種 として は、 ポリア クリルアミド・ 一 { CH - CH₂ } 一 が あり、 例 え ば 、

特公昭 4 6 - 3 8 8 8 8 の中でその使用が示されている。

しかし、このポリアクリルアミドも、濃度的に2 g / g 以下では光沢剤としての効果が十分でなく、また 1 0 g / g を超えるとめっき条件によってはめっき装価が灰色~ 黒色となる傾向が強くなってくる。また、めっき外限に及ぼす流速の影響が大きく、均一電源性に劣るなど、不倡合な点があった。

<発明の目的>

本発明は、以上のような現状に鑑み、光衣度が高く 美麗で かつ桁 紋が付着しにくい 電気 亜鉛めっきを広いめっき条件の範囲にわたって安定して得るための競性電気亜鉛めっき裕を提供することを目的とする。

<発明の構成>

水角明の第1の態機によれば、アクリルアミ

ドを主体とし、カチオン性モノマーを 1 ~ 2 0 モル 8 共重合させた

一般式

但し、武中

Y: Otth NH

X:ハロゲン、無機または有機酸除イオン

R₁ , R₂ , R₃ :

HattCH3 attC2 Hs

· n : 1 ~ 2

で示されるカチオン性基を含有するポリアクリルアミドを酸性電気亜鉛めっき裕中に0.2 ~ 2 0 g / 2 溶解せしめることにより、上記目的を達成することができる。

本発明の弟2の戀様によれば、アクリルアミドを主体とし、カチオン株 モノマーを1~20 モル%、ビニルモノマーを20モル%以下共爪合さ

せた

$$\begin{bmatrix}
CH - CH_2 \\
C = 0 \\
NH_2
\end{bmatrix}_X
\begin{bmatrix}
CH - CH_2 \\
C = 0 \\
(CH_2)_a \\
R_1 - N - X \\
R_2 R_3
\end{bmatrix}_Y$$

Y: O tttNH

X : ハロゲン、無機または有機酸路イオン R i 、 R 2 、 R 3 :

Hatter Ha atter Ha

n : 1 ~ 2

V. W: H. CNECHCOOH

で示されるカチオン性帯を含有するポリアクリルアミドを0.2 ~ 2 0 g/2 耐解せしめることにより、上記目的を連成することができる。

次に本発明の酸性光沢電気亜鉛めっき谷について詳細に説明する。

本 発明に おいて 用いられる 電気 亜鉛めっき 裕は、 破離 亜鉛、 塩化亜鉛、 あるいはそれらの 配合

物を主成分とし、これにアルカリ金属の硫酸塩、塩化物あるいはホウ酸塩や硝酸塩、その他の電調助剤や、pH級衡剤を添加し、pHをおよそ1~4の範囲に調整したところの酸性浴である。この浴に対し、カチオン性基を共取合したポリアクリルアミドを0.2~20g/2合有させる。

本発明のカチォン性族

Y:OttkNH

X:ハロゲン無機または有機酸陰イオン

R₁ , R₂ , R₃ :

HattlCH3 attlC2 H5

n : 1 ~ 2

を共乗合させたポリアクリルアミドはカチオン性 基を含まない ポリアクリルアミドとは異なり、 0.2 g/2という低い濃度からすでに光沢効果を 発揮し、電焼需度やめっき液焼の変化に対しても

安定で均一並消性に優れ、広いめっき条件の箱頭 でその有効性を発揮する。

一般に光沢剤は陰極姿面に析出した念底に吸着 し、 結晶化を阻害することによって、平滑で光沢 あるめっき表面をもたらすと考えられている。 本 発明のカチオン性基を共重合させたポリアクリル アミドが上記のようにすぐれた効果を発揮する形 由は光沢剤分子が裕中でカチオンに帯電し、機 表面に確化することによって、金属の析出反応を より効果的に翻御するためと考えられる。

この場合、光訳剤の中に占めるカチオン性 携が1 モル % 米機では、光訳剤分子のカチオン性が不十分であり、光訳剤としての効力はカチオン性が表を含まないポリアクリルアミドと大 だがない。また、20 モル % 超では、その機能を増加させても効果はほとんど変わらないばかりか、経済的にコストアップとなり評ましくない。したがって、光沢側中のカチオン性 基の含有量は 1 ~ 20 モル%と規定する。

また、水苑明の光沢前はその中に第3成分とし

てビニールモノマー CH = CH (V.W: V W COOH)

を共低合させることも可能である。

その一般式は下記のように表すことができる。 -40さ

$$\begin{array}{c}
-\begin{pmatrix} CH-CH_2 \\ C=O \\ NH_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} CH-CH_2 \\ C=O \\ Y \\ (CH_2)_n \\ R_1-N-X \\ R_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} CH-CH \\ V \\ W \end{pmatrix}_z$$

Y: O tttNH

X:ハロゲン、無機または有機酸路イオン

R₁ , R₂ , R₃ :

H t t t C H 3 t t t C 2 H 5

n : i ~ 2

V, W: H, CN tt COOH

ビニルモノマーを含有することにより、めっき 浴中での光沢削としての安定性を増し、高温での めっき、あるいは浴の長期間の使用にとって効果 がある。

ピニルモノマーの含有量が多すぎると、 光沢側

のみかけの分子形が大きくなり、於中で粘性が増 大するので、ビニルモノマー経加量は20モル% 以下にする必要がある。

上記の組成をもつ2種の光沢剤のめっき裕中の必要確度は0.2~20g/2である。0.2g/2 未満では光沢向上効果が少なく、また20g/2 を超えると高電液密度でめっき表面が黒っぽい相 雑な結晶となるいわゆるヤケを発生しやすくなる。

本発明における光訳剤の合成は、アクリルアミドモノマー C H 2 : C H C O N H 2 を主剤とし、カチオン性モノマーとしてジメチルアミノエチルメタアクリレート、ジメチルアミノエチルメタアクリロキシエチルアクロリド、トリメチルスタアクリロキシエチルアクリレート、トリエチルアクリロキシエチルアクリレート、トリエチルアクリロキシエチルアクリレート、トリエチルアクリロキシエチルアクリレート、トリエチルアクリロキシエチルアクリレート、トリエチルアクリカアミノメチルアクンモニウムクロリド等の中から1 種または 2 秤以

上を選らび、共取合させることによってなされる。また、第3成分としてビニールモノマーを添加する場合は、

アクリル的(CH₂:CHCOOH). マレイン酸 (HC-COOH) HC-COOH)

7クリルニトリル (CH2:CHCN) 等の中から 1 権あるいは 2 権以上を選らび、共宜合させればよい。

以上のようにして合成された光沢剤の分子量は 10万~150万の範囲にあるものが好ましい。

<実施例>

以下、本発明の好適実施例および比較例を挙げて説明する。

常 佐 に よって 脱脂、 静 洗 を した 厚 さ 0.8 mmの
 S P C C 鋼板に、 Z n S O a ・ 7 H 2 O 3 0 0
 g / 2 . N a 2 S O a 6 0 g / 2 を含み、 下記
 A ~ D の 光 沢 朝 を 添 加 し た p H 2.0 の め っ き が
 中 で 2 0 g / ㎡ 電気 め っ き を 施 し た。 なお、 この

うち、光訳削口は比較例のための光訳例である。

光沢 剤 A : アクリルアミド 9 0 モル%、ジメチルアミノエチルアクリレート 1 0 モル%、分子量約 9 0 万の共取合体

光沢削B: アクリルアミド80モル%. ジメチルアミノエチルアクリレート10モル%. アクリル酸10モル%. 分子 である 0 万の共電台体

光訳剤 C: アクリルアミド 8 5 モル%、トリメ チルアクリロキシエチルアンモニウ ムクロリド L 5 モル%、分子量約 5 0 万の共振合体・

光沢剤D:ポリアクリルアミド、

分子量的50万

光沢 削添加量は第1 裏に示すように0.1 ~ 2 5 g / 2 の範囲で2~3 水準に変えた。なお、めっき裕晶は5 5 でで一定とし、電流密度は20.40、80 A/d m² の3 水準とした。めっき後、水洗乾燥し、装前外観の均一性、光沢を料定したの

ち、水にラノリン、塩化ナトリウム、尿液、乳酸等を稀加、混合した人工丼液をスタンプし、 その目立ち易さにより指紋付着性を評価した。 これらの結果を第1表に示す。

実施例1~6に示した太条明の処理確によるでかっきは、いずれも抗飲付着性に優れていた。一方、光沢、指紋付着性に優れていは光沢の低すぎる比較例1、3は濃度の低すぎる比較例1、3は濃度の低すぎる比較例1、3は濃度の低すぎるになるにつれ、3は濃度の低するとは、光沢の高速になるのでした。さらにカチオとした比較例4、5では、温度が少なるにあり、また15gによりは大変を発生し、光沢、指数付着性ともに劣った。

<発明の効果>

従来のように、酸性電気亜鉛めっき粉に、ポ リアクリルアミドのみを添加するのではなく、ア

クリルアミドとカチオン性モノマーとのコポリ マー、あるいはアクリルアミドとカチオン性モノ マーとビニルモノマーとのコポリマーを添加する ことにより、光沢度が高く、美麗でかつ指紋が付 おしにくい電気亜鉛めっきを広いめっき条件の箱 囲にわたって安定して併ることができる電気亜鉛 めっき裕が得られる。

	光沢剤	光沢剤. 添加器 g/2	電 流 密 度 2 0 A/d m ²			電 流 密 度 4 0 A/d m ²			· 電 旅 密 度 8 O A/d m ²		
			外観均一性	光沢	指 紋 付着性	外 観 均一性	光沢	指 紋 付着性	外	光沢	指 紋 付着性
実施例1	Α	1.0	0	Δ	4	0	0	5	0	0	5
実施例2	Α	10.0	0	0	5	0	0	5	0	0	5
実施例3	В	0.5	0	۵	4	0	Δ.	4	0	0	5
実施例 4	В	15.0	0	0	5	0	0	5	0	0	5
実施例 5	С	1.0	0	0	4	0	0	5	0	0	5
実施例 6	С	15.0	0	0	5	0	0	5	0	0	5
比較例 1	Α	0 1	0	×	1	0	×	1	0	×	2
比較例 2	В	25.0	0	0	5	Δ	Δ.	2	×	×	2
比較例 3	С	0.1	0	×	1	0	×	ı	0	×	1
比較例 4	Q	1.0	0	×	1	0	×	1	o×	Δ	2
比較例 5	D	5.0	0	۵	2	o ×	۵	2	۵	Δ	2
比較例 6	D	15.0	0	Δ	4	Δ	Δ	2	×	×	1

(柱)外観均一性:〇…均一、〇×…わずかに不均一、△…やや不均一、×…不均一

光沢 : 〇…大、△…やや光沢あり、×…光沢なし